MANUFACTURE FOR INK-JET RECORDING HEAD

Patent number:

JP9136421

Publication date:

1997-05-27

Inventor:

KAMA HIROBUMI; WATANABE OSAMU; NODA KYOJI

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

B41J2/135; **B41J2/135**; (IPC1-7): B41J2/135

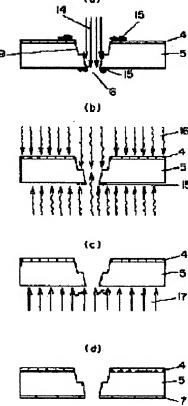
- european:

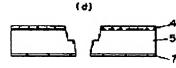
Application number: JP19950298047 19951116 Priority number(s): JP19950298047 19951116

Report a data error here

Abstract of JP9136421

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent ink from adhering or clogging in a recording head used in an ink-jet printer and prevent printing quality from being deteriorated. SOLUTION: A surface of an orifice plate 5 is treated by at least one or more of plasma processing, ion milling and inverse sputtering before a water repellant layer 7 is formed. Therefore, an adhesion of the water repellant laver 7 is improved. A heat-resistant resin sheet is attached to each side of a bonding resin layer 4 and the water repellant layer 7 of the orifice plate 5. In this state, an ink-boiling chamber 9 and an orifice 6 are formed by pulse laser processing. Accordingly, a by-product 15 generated through excimer processing can be completely removed.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-136421

(43)公開日 平成9年(1997)5月27日

(51) Int. C 1.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

B 4 1 J

3/04 1 0 3 N

技術表示箇所

B 4 1 J 2/135

審査請求 未請求 請求項の数4

ΟL

(全9頁)

(21) 出願番号

特願平7-298047

(22) 出願日

平成7年(1995)11月16日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 釜 博文

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 渡辺 修

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 野田 恭司

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

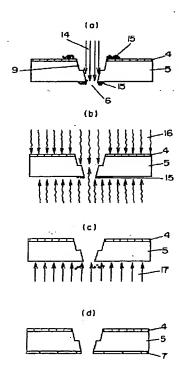
(74)代理人 弁理士 滝本 智之 (外1名)

(54) 【発明の名称】 インクジェット記録ヘッドの製造方法

(57) 【要約】

【課題】 インクジェットプリンタに使用される記録へッドにおいて、インクの付着や目詰まりを回避し、印字品質の低下を防ぐことができるインクジェット記録へッドの製造方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 オリフィスプレート5の表面を、プラズマ、イオンミリング、逆スパッタの少なくとも1種以上の工法により処理した後、撥水層7を形成させることにより撥水層7の密着力を向上させることができる。接合樹脂層4側及びオリフィスプレート5の撥水層7側に接合樹脂層側の耐熱性樹脂シート18a及びオリフィス側の耐熱性樹脂シート18bを貼り付けた状態で、インク沸騰室9及びオリフィス6をパルスレーザー加工により形成することにより、エキシマ加工で発生した副生成物15を完全に除去することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】オリフィス表面に撥水層を有するインクジェット記録ヘッドの製造方法であって、オリフィスプレートにパルスレーザーを照射して前記オリフィスを形成した後、イオンプローによって前記パルスレーザー加工時に発生した副生成物を除き、さらに、前記オリフィス表面をプラズマ、イオンミリング、逆スパッタの少なくとも1種以上の方法により処理し、その後、前記オリフィス表面に撥水層を形成することを特徴とするインクジェット記録ヘッドの製造方法。

1

【請求項2】インクを吐出するオリフィス表面に撥水層をもつかあるいはオリフィスプレート自体が撥水剤で構成されているオリフィスプレートを有するインクジェット記録へッドの製造方法であって、オリフィスプレートのインク流路側、インクを吐出するオリフィス側表面の少なくとも一方に、耐熱性樹脂シートを保護シートとして貼り付けた状態でパルスレーザーを照射して前記オリフィスを形成し、さらにその後、保護シートを剥がすことによって前記シート上に付着した副生成を除去することを特徴とするインクジェット記録へッドの製造方法。 【請求項3】オリフィスを形成するための前記パルスレーザーは、紫外光レーザーであることを特徴とする請求項1または2いずれか1記載のインクジェット記録へッドの製造方法。

【請求項4】前記紫外光レーザーは<u>エキシマレーザー</u>であることを特徴とする請求項3記載のインクジェット記録へッドの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェット記 30 録装置に用いるインクジェット記録ヘッドの製造方法に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピュータの出力用として使用されるプリンタには、印字の高速化、カラー化、低騒音化の要求が高まってきている。この中でインクジェットプリンタは、ノンインバクト記録方式であるため記録時の静粛性が図られ、インクを小滴化して飛翔させ、記録紙上に付着させて画像を形成するため高速記録が可能であり、また、特別な定着処理なしに普通紙に記録できるため用途分野が広範囲である。さらに、三原色のインクを別々に飛翔させることによりカラー化も容易である。このような特徴によって、家庭用、オフィス用コンピュータの出力用プリンタとして広く利用されるようになってきた。

【0003】インクジェット記録方式の印字機構は、小 滴の発生法や飛翔方向の制御法によってコンティニアス 方式とオンデマンド方式に大別され、現在、記録信号に 応じてインクを飛翔させる方式であるオンデマンド方式 が主流となっている。 【0004】コンティニアス方式は、例えば、米国特許第3060429号明細書に開示されている方式であって、インクの小滴化を静電吸引的に行い、発生した小滴を記録信号に応じて電解制御し、記録紙上に小滴を選択的に付着させて記録を行うものである。このコンティニアス方式は、小滴の発生に高電圧を要し、マルチノズル化が困難であるため高速記録には不適である。

【0005】オンデマンド方式は、例えば、米国特許第 34747120号明細書に開示されている方式で、小 滴を吐出するノズル孔を有する記録ヘッドに付設されて いるピエゾ振動素子に、電気的な記録信号を付加し、こ の電気記録信号をピエゾ振動素子の機械的振動に変え、 機械的振動によってノズル孔からインク小滴を吐出させ て記録紙に付着させることで記録を行うものである。す なわち、記録信号に対応したインク吐出を行う。このオ ンデマンド方式は、コンティニアス方式のように吐出飛 翔する小滴のうち、画像の記録に要さなかった小滴を回 収することが不要であるため、シンプルな構成が可能で ある。ただし、記録ヘッドの加工の困難さや、ピエゾ振 動素子の小型化が極めて困難でマルチノズル化が難し く、また、ピエゾ振動素子の機械振動という機械的エネ ルギーで小滴の飛翔を行うので、高速記録に向かない等 の欠点を有する。

【0006】更には、オンデマンド方式の他の例として、インクを加熱してインク中にバブルを発生させその体積変化でインクを飛翔させる、いわゆるバブルジェット方式がある。例えば、米国特許第3179042号明細書(スペリーの特許)に開示されている方式は、ビエゾ振動素子等の手段による機械的振動エネルギーを利用する代わりに、熱エネルギーを利用することが記載されており、機械的振動エネルギーを利用する方式と比較し、エネルギー変換効率が高く、マルチノズル化が容易であるといった特徴がある。

【0007】図6は、交流電流通電による高周波加熱でインクが沸騰し、バブルを発生させその体積変化でインクを吐出させる従来の通電方式を用いたインクジェット記録ヘッドの要部断面図である。

【0008】図6において、1は一対の対向電極とインク沸騰室とオリフィスとを複数設けるための基材、2a,2bはインク室内に導電性インクに接するように配置された信号電極、5はオリフィス6を複数有するオリフィスプレート、6は導電性インクを吐出するオリフィス、8は導電性インク、9は導電性インク8で満たされたインク沸騰室、10はインク沸騰室9内に発生した沸騰気泡、11はオリフィス6から吐出されるインク滴、12は記録媒体としての記録用紙、13は信号電極2a,2bに電圧を印加するための駆動装置、13a,13bは信号電極2a,2bを各々駆動するために駆動装置13内に設けられたドライバ、19は導電性インク8を収容するインクタンク、20は複数のインク沸騰室9

3

に導電性インク8を供給するための共通インク室、21はインクタンク19から共通インク室20へ導電性インク8を供給するためのインク流路、22は駆動装置13と信号電極2a,2bを接続する導線をそれぞれ示す。

【0009】以上のように構成された従来のインクジェットプリンタについてその動作原理を以下に説明する。

【0010】駆動装置13をONすることにより、信号 電極 2 a,2b間に高周波電圧が印加され、導電性イン ク8に電流が流れ、インク中に存在する電解質が振動運 動を行う。その結果、ジュール熱が発生し、信号電極 2 a, 2bの先端間の導電性インク8が沸騰する。このイ ンクの沸騰により沸騰気泡 10が発生し、この沸騰気泡 10の圧力によってオリフィス6からインク滴11が吐 出され、記録媒体12に印字ドットが形成される。基材 1上には複数のインク滴11を吐出することが可能とな るように信号電極2a,2b、オリフィス6、インク沸 騰室9が複数設けられ、駆動装置13により複数のオリ フィス6から選択的にインク滴11が吐出され、記録媒 体12に所望の文字を形成できるようにしている。この 後、駆動装置13をOFFすることにより、信号電極2 a, 2 b間の高周波電圧が除かれてインクは急激に冷却 され、気泡が消滅し初期の状態に戻る。

【0011】図7は複数のオリフィスが同一基材上に形成されたインク吐出装置の要部拡大斜視図である。1は基材、2a,2bは信号電極、5は複数のオリフィス6が形成されたオリフィスプレート、6はオリフィス、9はインク沸騰室、11は吐出されたインク滴、20は各々のインク沸騰室9と連通した共通インク室である。

【0012】このような構成の記録ヘッドにおいて、オリフィス6を加工する手段として、エキシマレーザー、 CO_2 レーザー,YAGレーザーなどの各種レーザーが用いられている。中でもエキシマレーザーは紫外光を発振し、アプレーションと呼ばれる現象によって加工が進むことから、 CO_2 レーザー,YAGレーザーに比べて加工部分の断面やエッジをきれいに仕上げることができるため、エキシマレーザーによるオリフィスの加工が主流になりつつある。

【0013】また、インクが吐出するオリフィスプレート5表面の撥水性が不十分であると、インク滴11がオリフィス6周辺に不均一に溜まるようになり、吐出インクの飛翔方向が乱れ、良好な記録が行われなくなる。この対策として、インク吐出オリフィスプレート表面、もしくはオリフィス6周辺に撥水処理を施すことが行われている。

[0,014]

【発明が解決しようとする課題】このような記録ヘッドでは、通常記録ヘッドのオリフィス近傍は常にインクと接しているため、そのインクを除去するためのバージ,ブレード等の回復操作が行われている。この回復操作によって撥水層が擦られ、磨耗したり、甚だしい場合には 50

撥水層が剥離することがある。また、撥水層を形成する オリフィスプレート上に汚れが存在すると、記録ヘッド を使用しているうちに撥水層が剥離したり、抜け落ちた りすることもある。このような撥水層の剥離等によっ て、インク溜まりが発生したり、剥離物がインク吐出口

に詰まり、印字品質の低下を招いていた。

【0015】また、エキシマレーザーを照射してインク 吐出口となるオリフィスを加工する際、樹脂が分解し副 生成物 (例えばカーボン)が発生し、これが、オリフィス近傍及びインク流路内に堆積するが、この副生成物 は、オリフィスプレートへの付着力が強く、超音波洗浄 等では完全に除去することができない。この副生成物がインク吐出口となるオリフィス近傍に付着した場合、付着箇所が親水性を示す状態になり、そこにインク溜まりが発生する。これによって、インク滴の直進性は失われ、印字品質の低下を招いていた。また、インク流路内に付着した場合、インク中に剥離、浮遊してオリフィスに詰まり、吐出不良となって印字品質の低下を引き起こしていた。

20 [0016]

【課題を解決するための手段】本発明は、上述した従来の課題を解決するためになされたものであり、オリフィス表面に撥水層を有するインクジェット記録へッドの製造方法であって、オリフィスプレートにバルスレーザーを照射して前記オリフィスを形成した後、イオンブローによって前記パルスレーザー加工時に発生した副生成物を除き、さらに、前記オリフィス表面をプラズマ、イオンミリング、逆スパッタの少なくとも1種以上の方法により処理し、その後、前記オリフィス表面に撥水層を形成することを特徴とするインクジェット記録へッドの製造方法である。

【0017】また、インクを吐出するオリフィス表面に 撥水層をもつ、あるいはオリフィスプレート自体が撥水 剤で構成されているオリフィスプレートであって、オリ フィスプレートのインク流路側、インクを吐出するオリ フィス側表面の少なくとも一方に、耐熱性樹脂シートを 保護シートとして貼り付けてパルスレーザーを照射して 前記オリフィスを形成し、さらにその後、保護シートを 剥がすことによってシート上に付着した副生成物を除去 することを特徴とするインクジェット記録ヘッドの製造 方法である。

【0018】この発明によれば、撥水層の密着力を向上させ、オリフィスプレートに対してバルスレーザーを照射してオリフィス加工する際、オリフィス側もしくはインク流路側に親水性の大きい副生成物が付着するのを防ぐことができ、これによって、オリフィス近傍へのインクの付着やオリフィスへの副生成物の目詰まりを回避し、印字品質の低下を防ぐことができる。

[0019]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1記載の発明は、

30

オリフィス表面に撥水層を有するインクジェット記録へ ッドの製造方法であって、オリフィスプレートにパルス レーザーを照射して前記オリフィスを形成した後、イオ ンプローによって前記パルスレーザー加工時に発生した 副生成物を除き、さらに、前記オリフィス表面をプラズ マ、イオンミリング、逆スパッタの少なくとも 1 種以上 の方法により処理し、その後、前記オリフィス表面に撥 水層を形成することを特徴とするインクジェット記録へ ッドの製造方法であり、オリフィスプレート上の汚れ、 有機物及びパルスレーザー加工時発生した副生成物を除 10 去することができるため、付着力の強い撥水層を形成す ることができるという作用を有する。その結果、記録へ ッド使用時にオリフィス近傍の撥水層剥離を防止するこ とができるため、オリフィス近傍へのインク付着を防ぐ ことができ、インク滴の飛翔方向が安定し、印字品質の 低下を防ぐことができる。

【0020】請求項2記載の発明は、インクを吐出する オリフィス表面に撥水層をもつ、あるいはオリフィスプ レート自体が撥水剤で構成されているオリフィスプレー トであって、オリフィスプレートのインク流路側、イン クを吐出するオリフィス側表面の少なくとも一方に、耐 熱性樹脂シートを保護シートとして貼り付けてパルスレ ーザーを照射して前記オリフィスを形成し、さらにその 後、保護シートを剥がすことによってシート上に付着し た副生成物を除去することを特徴とするインクジェット 記録ヘッドの製造方法であり、パルスレーザー加工時発 生した副生成物がオリフィスプレート上に付着するのを 防止することができるため、オリフィス近傍へのインク 付着を防ぐことができ、インク滴の飛翔方向が安定し、 印字品質の低下を防ぐことができるという作用を有す る。

【0021】以下、本発明の実施の形態について図面を 参照しながら説明する。

(実施の形態1)図1は本発明の実施の形態1における インクジェット記録ヘッドの要部断面図である。図1に おいて、1は基材、2a及び2bは同一の形状を有し、 基材1上にパターン形成された信号電極、3は絶縁層、 4は接合樹脂層、5はオリフィス6を有するオリフィス プレート、7は撥水層、8は導電性インク、9はインク 沸騰室、10はインク沸騰室9内に発生した沸騰気泡、 11はオリフィス6から吐出されるインク滴、12は印 字が行われる記録媒体としての記録用紙、13は信号電 極 2 a, 2 b に電圧を印加するための駆動装置である。

【0022】基材1の材料としては、ガラス、セラミッ ク等の絶縁材料、半導体、表面を高抵抗材料で被覆した 金属、金属合金、絶縁物、半導体が使用できる。ガラス 基板としては、カリ石灰ガラス、ソーダ石灰ガラス、硼 珪酸ガラス、クラウンガラス、亜鉛クラウンガラス、ソ ーダカリガラス、バリウム硼珪酸ガラス、96%珪酸ガ ラス,99.5%珪酸ガラス,燐酸ガラス,低融点ガラ 50 オリフィスプレートとの密着力が弱い場合には、撥水層

ス, リチウム珪酸ガラス, 亜鉛アルミ珪酸ガラス, 珪酸 ジルコニウムガラス等が使用できる。また、セラミック 基板としては、酸化アルミニウム(アルミナ),酸化チ タン (チタニア), MgO·SiO2 (ステアタイ ト), 2MgO·SiO₂ (ホルステライト), BeO (ベリリア), MgO・Al2O3 (スピネル) 等が使 用できる。半導体基板としては、シリコン、炭化シリコ ン、ダイアモンド、ゲルマニウム等が使用できる。

【0023】信号電極2a,2bの材料としては、Ti 族金属(Ti, Zr, Hr)、白金族金属(Pt, R u. Rh. Pd, Os, Ir)、高融点金属(W, T a, Mo)、その他V, Cr, Fe, Co, Ni, N b, Au, Ag, Al等の単金属又はこれらの合金(N i-Fe, NiCr, TiCr等) が使用できる。ま た、これらの酸化物(酸化チタン、酸化ハフニウム、酸 化錫,酸化インジウム等)、窒化物(窒化チタン,窒化 クロム等)、炭化物(炭化チタン,炭化タングステン 等)、硼化物も使用できる。

【0024】絶縁層3としては、有機高分子はポリイミ ド、ポリアミドイミド、尿素樹脂、フェノール樹脂、エ ポキシ樹脂、フッ素樹脂、アクリル樹脂、及びシリコン 樹脂等の有機高分子が挙げられるが、ポリイミド等の耐 熱性高分子が特に好ましい。また、ゾルゲル法に用いら れる金属アルコキシドを使用してもよいし、SiO2, Al₂O₃, TiO₂等の金属酸化物を蒸着法やスパッ タ法にて形成してもよい。

【0025】接合樹脂層4としては、エポキシ樹脂,ポ リイミド樹脂、トリアジン樹脂、アクリル樹脂、ポリウ レタン樹脂,シリコン樹脂,尿素樹脂等の熱硬化性樹脂 が使用できる。可撓性を付与するためにニトリルゴム、 シリコンゴム,ナイロン,ポリエステル樹脂等の熱可塑 性樹脂を添加することもできる。また、SiO2,Al 2 Oa. TiO2等の金属酸化物の微粉を充填材として 添加してもよく、接着性を向上させるためにカップリン グ剤を適量添加してもよい。耐インク性、耐熱性を考慮 するとエポキシ樹脂、及びまたはポリイミド樹脂が好ま しい。接合樹脂層は所定の膜厚を得る濃度に有機溶剤で 希釈し、あらかじめ樹脂シートに塗布した後、加熱によ り溶剤を揮発させ接合樹脂を形成する。

【0026】オリフィスプレート5としては、ポリイミ ド、ポリアミドイミド、ポリエーテルスルホン、ポリフ ェニレンスルフド、ポリエーテルエーテルケトン等の耐 熱性エンジニアリングプラスチックが使用できるが、耐 インク性、レーザー加工性を考慮するとポリイミド、ポ リエーテルスルホンが好ましい。

【0027】撥水層7としては、アルキルポリフルオロ カーポン等のフッ素を含む高分子化合物、あるいは、へ プタデカフルオロデシルトリメトキシシラン等のフッ素 を含む有機ケイ素化合物を用いることができる。また、

用いた。

の下地としてたとえば二酸化ケイ素等を形成することが できる。

【0028】次に、上記の材料を用いて記録ヘッドを作 製する方法の一例を述べる。ガラス,あるいはシリコン 等のセラミクスからなる非導電性の基材 1 上に、Ti. Au、Pt等の導電性金属膜を蒸着法やスパッタ法など の物理成膜法あるいは鍍金法等により積層する。この金 属膜を積層した基材にフォトリソグラフィ法により電極 パターンを形成し、電極以外の部分をイオンミリングま たはケミカルエッチングにより除去し、信号電極 2 a. 2 b を形成する。次いで、インク沸騰室 9 に露出してい ない電極と基材上に有機高分子あるいはセラミクス等の 絶縁層 3 を塗布または蒸着法やスパッタ法により形成す る。この絶縁膜と電極を積層した基材上にエキシマレー ザー加工機により形成されたオリフィス6を有するオリ フィスプレート5とオリフィス6の中心が二つの電極の 中心と一致するように接着層で接着することにより、図 1に示す記録ヘッドを作製する。

【0029】次に、オリフィス6からインク滴を噴射す る動作について説明する。基材1に設けられた一対の信 20 号電極2a,2bに、駆動装置13から電圧(本実施の 形態では10~30V)が印加されると、ある抵抗率

(本実施の形態では 2 0 ~ 5 0 Ω · c m) を有する導電 性インク8を介して、信号電極2a,2b間に電気力線 が発生する。この電気力線に沿って電流が流れ、 | 2 × R(I:電流値、R:導電性インク8の抵抗)で表され る電流のジュール損失によって、電気力線の電流集中部 におけるインクが自己発熱して10~20μs後につい には沸騰が始まり、沸騰気泡10が発生する。発生した 気泡が膨張することによって、インク沸騰室9内の導電 30 性インク8の圧力が急激に高まり、この圧力を解放しよ うとする力によってインクはオリフィス6からインク滴 11となって噴射され、記録用紙12に付着してドット を形成する。

【0030】図2は本発明の実施の形態1におけるオリ フィス加工の処理手順を示す加工工程概略図であり、同 図を参照してオリフィス加工工程について説明する。

【0031】まず、図2(a)に示すように、予めエポ キシ系の接合樹脂層 4 を 3 μm塗布してあるポリイミド 系のオリフィスプレート5に、エキシマレーザー光14 を用いてインク沸騰室9、オリフィス6を加工する。こ こで15は、エキシマ加工で発生した副生成物である。 次に、図2(b)に示すように、イオンガンによるイオ ンプロー16によってエキシマ加工で発生した副生成物 15をできる限り除去する。次に、図2(c)に示すよ うに、インクが吐出するオリフィス6面側にイオンミリ ング処理を施し、オリフィスプレート 5上の強固に付着 した副生成物及び有機物層を完全に除去する。イオンミ リング処理は、COMMON WEALTH SCIE

 $\times 10^{-4}$ Torr, Power 200V, 100mA, 処理時間 1 0 分で行った。次に、図 2 (d) に示すよう に、撥水層7として、イオンミリング処理面に蒸着装置 の電子ピームによる加熱蒸発を利用して二酸化ケイ素薄 膜を500Å程度形成した後、その上にフッ素含有アミ ノシラン化合物を100Å程度の膜厚になるように形成 した。蒸着装置には、アネルバ社製EVC-500Aを

【0032】以上、一連の処理で得られた撥水層付きの 10 オリフィスプレート5について、次の方法で撥水性、耐 磨耗性を評価した。また、実際に図1に示した記録へッ ドを作製し、目詰まりによるドット抜け、オリフィス6 近傍の撥水膜剥離や異物付着による着弾位置ズレ等の印 字品質を評価した。

【0033】(1) 撥水性 : 協和化学(株) 製 接触 角計(CA-S150)を用いて蒸留水による液適法で 測定した接触角で評価した。

【0034】(2)密着性 :蒸留水中で超音波洗浄3 0分後の蒸留水による接触角測定で評価した。

【0035】(3) 耐磨耗性:1) 磨耗試験機UMGS - 7 を用いて、摺動速度 3 0 0 0 mm/m i n, ラバー 硬度60°で摺動回数3000回後の蒸留水による接 触角で評価した。

【0036】2)撥水膜表面を木綿で1kgの荷重にて 500回磨耗試験後、傷、汚れ等の表面状態を観察し た。判定基準を以下に示す。

[0037]

○:無傷である。

 $\Delta: 1 \sim 10$ 本の細かい傷がつく。

【0038】×:無数の傷がつく。もしくは撥水膜が剥 離する。

(4) 印字品質:前記条件で印字したサンプルにおける ドット抜け及び着弾位置ズレ等の印字品質を評価した。 判定基準を以下に示す。

【0039】○:ドット抜け及び着弾位置ズレがなく、 印字品質良好。

△:ドット抜け及び着弾位置ズレは有るが、文字の判別 可能。

【0040】×:ドット抜け及び着弾位置ズレがひど く、文字の判別不可能。

【0041】評価結果は、(表1)に示す通り良好な結 果が得られている。耐磨耗試験において若干の接触角低 下がみられたが、十分に撥水効果を維持している。

【0042】なお、ミリング条件は、Arガス圧等他の 条件でもよく、蒸着装置の加熱手段も、抵抗加熱、ハロ ゲンランプ加熱等による方法でもよく、本実施の形態1 に限定されるものではない。また、接合樹脂層3、撥水 層7の物質、及びオリフィスプレートと撥水層間の膜も 上記の材料、膜厚、層数に限定されるものではない。さ NTIFIC社製ミリング装置を用いて、Arガス圧2 50 らに、撥水層形成法においてもスパッタ等による方法で

もよく、本実施の形態1に限定されるものではない。

*【表 l 】

[0 0 4 3]

	処理方法	(1)撥水性	(2)密着性	(3)耐磨耗性		(4)印字品質
				接触角	表面状態	(4)41-22 M
実施例1	イオンミリング	112*	110	100*	0	0
英遊例 2	遊スパッタ	108°	107*	98"	0	0
実施例 3	0. プラズマ	110°	108	101°	0	0
比較例1	処理無し	105°	85*	6 2 °	×	×

【0044】(実施の形態2)本実施の形態における記 録ヘッドは、実施の形態Ⅰと同様の構造のものである が、インクが吐出するオリフィス6面側に逆スパッタ処 理を施した後、撥水層7として、二酸化ケイ素薄膜を5 00 Å形成し、その上にフッ素含有アミノシラン化合物 を100Å程度の膜厚になるように形成したものであ る。装置はアネルバ社製3105スパッタ装置を用い、 逆スパッタ条件は、Ar圧10mtorr, Power 200W, 処理時間10minで行った。

【0045】評価は実施の形態1と同じ方法で実施した が、(表1)に示すように良好な結果が得られた。な お、逆スパッタ条件は、Arガス圧等他の条件でもよ く、本実施の形態2に限定されるものではない。

【0046】(実施の形態3)本実施の形態3における 記録ヘッドは、実施の形態 1 と同様の構造のものであ る。本実施の形態3では、インクが吐出するオリフィス 6面側にO2プラズマ処理を施した後、撥水層7とし て、二酸化ケイ素薄膜を500Å形成し、その上にフッ 素含有アミノシラン化合物を100Å程度の膜厚になる ように形成したものである。ミリング装置は、東京応化 工業(株)製OAPM-400を用い、条件は、Pow er200W, 処理時間5minで行った。

【0047】評価は実施の形態1と同じ方法で実施して おり、(表1)に示すように良好な結果が得られた。

【0048】なお、O₂プラズマ条件は、Power等 他の条件でもよく、本実施の形態3に限定されるもので はない。

【0049】(比較例1)図3は比較例1におけるオリ フィスプレート加工の処理手順を示す加工工程概略図で ある。本比較例1における記録ヘッドは、実施の形態1 と同様の構造のもので、図3(a)に示すように、本比 較例1では、まず、オリフィスプレート5に、エキシマ レーザーを用いてインク沸騰室9、オリフィス6を加工 する。次に、図3(b)に示すように、イオンプローに よるエキシマ加工で発生した副生成物15の除去、及び インクが吐出するオリフィス6面側にイオンミリング, 逆スパッタ, O2 プラズマ等の処理を行わず、撥水層 7 を形成したものである。

【0050】評価結果を(表1)に示す。撥水性は、実 施の形態1,2,3と同様に良好な結果が得られたが、 密着性及び耐磨耗性は、オリフィスプレート 5 上の汚れ 部分では二酸化ケイ素薄膜及び撥水層 7 からの剥離が観 50 態 5 における記録ヘッドの作製工程図を示したもので、

察された。また、エキシマ加工で発生した副生成物15 10 付着部分では、副生成物からの剥離が観察され、密着性 も低く、耐磨耗性も悪かった。印字品質においては、印 字途中で剥離物目詰まりによるドット抜け、及びオリフ ィス近傍の撥水膜剥離による着弾位置ズレが発生し、良 好な印字が得られなかった。

10

【0051】(実施の形態4)図4は本発明の実施の形 態4における記録ヘッドの作製工程を示したもので、図 4 (a) は、本実施の形態 4 で用いたオリフィスプレー ト5の断面図である。予めエポキシ系の接合樹脂層4を 3μm塗布してあるポリイミド系のオリフィスプレート 5に、厚さ10μmのポリイミド系の接合樹脂層側の耐 熱性樹脂シート18a, オリフィス側の耐熱性樹脂シー ト18bを保護シートとして貼り合わせてある。次に、 エキシマレーザー光 1 4 を接合樹脂層 4 側から照射して インク沸騰室9及びオリフィス6を形成した(図4 (b))後、エキシマレーザー加工終了後にエキシマ加 工で発生した副生成物 1 5 が付着したオリフィス 6 側の オリフィス側の耐熱性樹脂シート18bを剥がし、実施

の形態1と同じイオンミリング17を施した後(図4 (c))、撥水層7を形成した。次に、撥水層7形成 後、接合樹脂層4側の接合樹脂層側の耐熱性樹脂シート 18aを剥がして(図4(d))、電極及び絶縁層3が 形成してある基材1に接着して実施の形態1に示した記 録ヘッドを完成した。

【0052】評価は実施の形態1と同じ方法で実施して おり、(表2)に示すように良好な結果が得られた。

【0053】なお、エキシマレーザー加工方向はオリフ ィス6側からでもよく、本実施の形態4に限定されるも のではない。また、接合樹脂層側の耐熱性樹脂シート1 8 a, オリフィス側の耐熱性樹脂シート18 bは、ポリ イミド, ポリアミドイミド, ポリエーテルスルホン, ポ リフェニレンスルフド, ポリエーテルエーテルケトン等 の耐熱性エンジニアリングプラスチックが使用できる が、エキシマレーザー加工性を考慮するとポリイミド、 ポリエーテルスルホンが好ましい。接合樹脂層側の耐熱 性樹脂シート18a、オリフィス側の耐熱性樹脂シート 18bの厚みは、エキシマレーザー加工性を考慮して好 ましくは $5\sim35\mu m$ 、より好ましくは $5\sim15\mu m$ が 望ましい。

【0054】 (実施の形態5) 図5は本発明の実施の形

図 5 (a) は本実施の形態 5 で用いたオリフィスプレート 5 の断面図を示す。同図において、 4 は接合樹脂層、 5 はオリフィスプレート、 1 8 a は接合樹脂層側の耐熱性樹脂シート、 1 8 b はオリフィス側の耐熱性樹脂シートである。予めポリイミド系のオリフィスプレート 5 の片面に接合樹脂層 4 を 3 μ m塗布及び反対側の面に撥水層 7 を形成し、さらに厚さ 1 0 μ mのポリイミド系の接合樹脂層側の耐熱性樹脂シート 1 8 a , オリフィス側の耐熱性樹脂シート 1 8 b を保護シートとして接合樹脂層 4 及び撥水層 7 面上に貼り合わせてある。次に、図 5 (b) に示すように、エキシマレーザー光 1 4 を接合樹

4及び撥水層 7 面上に貼り合わせてある。次に、図 5 (b)に示すように、エキシマレーザー光 1 4 を接合樹脂層 4 側から照射してインク沸騰室 9 及びオリフィス 6 を形成した。次に、図 5 (c)に示すように、エキシマレーザー加工終了後、エキシマ加工で発生した副生成物 1 5 が付着した接合樹脂層側の耐熱性樹脂シート 1 8 b を剥がし、電極及び絶縁層 3 が形成してある基材 1 に接着して実施の形態 1 に示した記録ヘッドを完成した。

【0055】評価は実施の形態1と同じ方法で実施しており、(表2)に示すように良好な結果が得られた。

【0056】なお、エキシマレーザー加工方向はオリフィス6側からでもよく、本実施の形態に限定されるものではない。また、実施の形態5で用いたオリフィスプレート5は、オリフィスプレート5自体が撥水性を持つものにも有効であり、本実施の形態に限定されるものではない。

[0057]

【表 2 】.

	(1)榖水性	(2)密着性	(3)耐息	(OCC)		
	山景水丘	(2/社/省社	接触角	表面状態	(4)甲字品質	
実施例 4	113°	110	100"	0	0	
美益例 5	111"	109*	98.	0	0	

[0058]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、撥水層の 形成前にオリフィスプレートのインクが吐出するオリフィス表面をプラズマ、イオンミリング、逆スパッタの少なくとも1種以上の工法により処理し、撥水層の密着力を向上させることで、パージ、プレード等の回復操作による撥水層の剥離を防止することができる。

【0059】また、オリフィスプレートのインク流路側、インク吐出側表面に保護シートを設けることにより、例えばエキシマレーザーの照射により発生した副生成物を完全に除去することができる。従って、記録ヘッド使用時にオリフィス近傍へのインク付着を防ぐことが

できるため、インク滴の飛翔方向が安定し、印字品質の低下を防ぐことができるという有利な効果が得られる。 また、副生成物の脱落が無く、それによる目詰まりによる不吐出等のない、長期信頼性を満足するインクジェット記録ヘッドの供給が可能となる。

12

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1におけるインクジェット 記録ヘッドの要部断面図

【図2】本発明の実施の形態1におけるオリフィス加工 10 の処理手順を示す加工工程概略図

【図3】比較例1におけるオリフィスプレート加工の処理手順を示す加工工程概略図

【図4】本発明の実施の形態4における記録ヘッドの作製工程図

【図5】本発明の実施の形態5における記録ヘッドの作 製工程図

【図6】従来の通電方式を用いたインクジェット記録へッドの要部断面図

【図7】複数のオリフィスが同一基材上に形成されたイ 20 ンク吐出装置の要部拡大斜視図

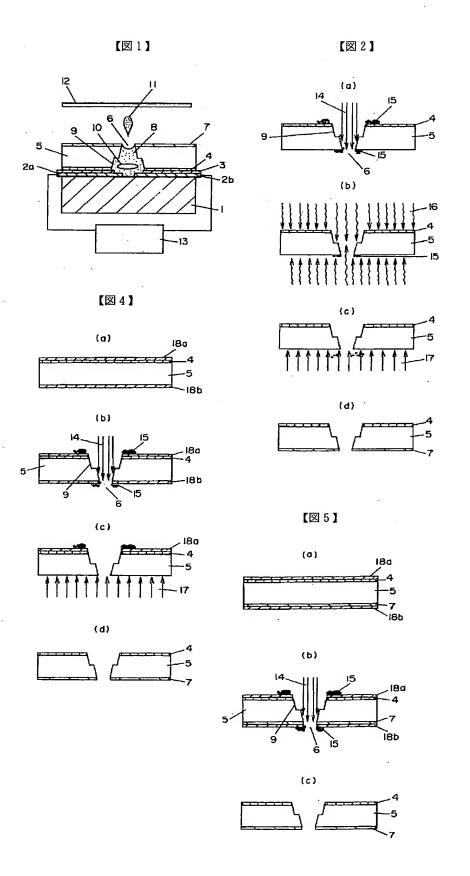
【符号の説明】

- 基材
- 2 a 信号電極
- 2 b 信号電極
- 3 絶縁層
- 4 接合樹脂層
- 5 オリフィスプレート
- 6 オリフィス
- 7 撥水層
- 30 8 導電性インク
 - 9 インク沸騰室
 - 10 沸騰気泡
 - 11 インク滴
 - 12 記錄用紙(記錄媒体)
 - 13 駆動装置
 - 14 エキシマレーザー光
 - 15 エキシマ加工で発生した副生成物
 - 16 イオンブロー
 - 17 イオンミリング
- 40 18a 接合樹脂層側の耐熱性樹脂シート
 - 18b オリフィス側の耐熱性樹脂シート
 - 19 インクタンク
 - 20 共通インク室
 - 21 インク流路
 - 2 2 導線

【図3】

(a)

(b)



[図 6]
[図 7]